

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 7 月 19 日 (2007.7.19)

【公表番号】特表 2007-501431(P2007-501431A)

【公表日】平成 19 年 1 月 25 日 (2007.1.25)

【年通号数】公開・登録公報 2007-003

【出願番号】特願 2006-522529(P2006-522529)

【国際特許分類】

G 0 3 F 1/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 1/08 B

H 0 1 L 21/30 5 2 9

H 0 1 L 21/30 5 0 2 C

G 0 3 F 7/20 5 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 5 月 31 日 (2007.5.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

エネルギー・ビーム及びマルチ・パス描画方式を使用して、前記エネルギー・ビームに感応する層をコーティングしたワークピース上にパターン形成されたフィーチャの限界寸法均一性を改善するためのリソグラフィ法であって、

描画パスが、前記コーティングにほぼ同等に影響を及ぼすように、前記パスに対する個々の線量を決め、それによりフィーチャの限界寸法均一性を改善する工程と、

前記マルチ・パス描画方式を使用し、前記描画パスにおいて前記個々の線量を加えながら、前記コーティングを露光させる工程と、

前記コーティングを現像する工程と

を含む方法。